

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА И ПОЛИМЕРНЫХ СЛОЕВ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

ПЛАЗМА ТМ200-03К

Назначение: Процессы плазмохимического удаления фоторезистивной маски и травления органических полимеров.



Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: \varnothing 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек из кассеты в кассету;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Рабочие газы: H_2-N_2 , O_2 , CF_4 , N_2 ;
- Нагреваемый подложкодержатель до $250^{\circ}C$;
- СВЧ источник удаленной плазмы для травления радикалами;
- Мощность потребления не более 15,5 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

